

(8) - 1

2020年国際特許分類サブクラスに基づく特許新規出願件数ランキング
(前20位)

順位	国際特許分類 (サブクラス)	分類内容の概要	件数
1	H01L	半導体装置, 他に属さない電氣的固体装置	5,317
2	G06F	電氣的デジタルデータ処理	2,652
3	A61K	医薬用, 歯科用又は化粧用製剤	1,462
4	G06Q	電子商取引	1,231
5	G02B	光学要素, 光学系, または光学装置	1,040
6	C07D	複素環式化合物	1,039
7	H04W	無線通信ネットワーク	828
8	H05K	印刷回路; 電氣装置の箱体または構造的細部, 電氣部品の組立体の製造	821
9	H04N	画像通信	820
10	G03F	フォトメカニカル法による凹凸化又はパターン化された表面の製造; そのための材料; そのための原稿; そのために特に適合した装置、露光装置など	767
11	C08G	炭素-炭素不飽和結合のみが関与する反応以外の反応によって得られる高分子化合物	760
12	C23C	金属質への被覆; 金属材料による材料への被覆; 真空蒸着, スパッタリング, イオン注入法または化学蒸着による被覆一般	731
13	G01N	材料の化学的または物理的性質の決定による材料の調査または分析	726
14	B32B	積層体, すなわち平らなまたは平らでない形状, 例. 細胞状またはハニカム状の層から組立てられた製品	668
15	C07K	ペプチド	630
16	G11C	静的記憶	580
17	C08L	高分子化合物の組成物	531
18	H04L	デジタル情報の伝送	530
19	A61B	診断; 手術; 個人識別	524
20	G01R	電氣的変量の測定; 磁氣的変量の測定	509

統計資料: 2022年1月11日

注:

1. 特許出願件数に基づくランキング
2. 詳細な国際特許分類内容の描述は国際特許分類第 2021.01 版参照
3. 新規出願の分類の時間差により、リアルタイムで当年度年報の件数を提供できないので、年報の年度における一年前の件数を統計の根拠とする。